

Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



AN
A.0

(11) **EP 1 063 551 A1**

(12) **EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG**

(43) Veröffentlichungstag:
27.12.2000 Patentblatt 2000/52

(51) Int. Cl.⁷: **G02B 13/14, G02B 13/24**

(21) Anmeldenummer: 00108927.5

(22) Anmeldetag: 27.04.2000

(84) Benannte Vertragsstaaten:
**AT BE CH CY DE DK ES FI FR GB GR IE IT LI LU
MC NL PT SE**
Benannte Erstreckungsstaaten:
AL LT LV MK RO SI

(72) Erfinder: **Schuster, Karl-Heinz**
89551 Koenigsbronn (DE)

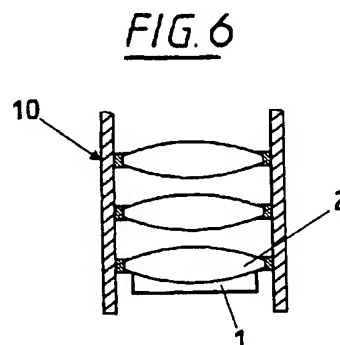
(74) Vertreter:
Lorenz, Werner, Dr.-Ing.
Lorenz & Kollegen,
Fasanenstrasse 7
89522 Heidenheim (DE)

(30) Priorität: 26.06.1999 DE 19929403

(71) Anmelder: **Carl Zeiss**
89518 Heidenheim (Brenz) (DE)

(54) **Objektiv, insbesondere Objektiv für eine Halbleiter-Lithographie-Projektionsbelichtungsanlage und Herstellungsverfahren**

(57) Bei einem Objektiv 10, insbesondere bei einem Objektiv für eine Halbleiter-Lithographie-Projektionsbelichtungsanlage, mit mehreren in Fassungen gelagerten optischen Elementen ist das in Strahlrichtung letzte optische Element 1 fassungsfrei und auswechselbar direkt mit dem vorletzten optischen Element 2 verbunden. Die Verbindung kann durch Ansprengen einer dünnen äquidistanten Platte als letztem optischen Element 1 erfolgen.



EP 1 063 551 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Objektiv, insbesondere Objektiv für eine Halbleiter-Lithographie-Projektionsbelichtungsanlage, mit mehreren in Fassungen gelagerten optischen Elementen. Die Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstellung eines optischen Elementes.

[0002] Die in der Lithographie verwendeten Resiste werden zunehmend mit höheren Pulsleistungen und Pulszahlen eines Lasers belastet. Resiste bestehen im allgemeinen aus Kunststoff und werden bei der Beaufschlagung mit Laserlicht verändert, wobei sie Emissionen abgeben, welche für die optischen Elemente des in der Halbleiter-Lithographie-Projektionsbelichtungsanlage verwendeten Objektivs schädlich sind. Dies gilt insbesondere für die optischen Abschlußflächen, die auf diese Weise im Laufe der Zeit ihre Brauchbarkeit verlieren.

[0003] Bekannt ist es deshalb, das Objektiv unter einen bestimmten Überdruck zu setzen, wozu kontinuierlich Gas eingeleitet wird, um die Optik stets sauber zu halten. Auf diese Weise wird verhindert, daß Verunreinigungen von außen nach innen dringen, denn im Inneren des Objektivs herrscht stets ein leichter Überdruck. Auf der zu dem Resist gerichteten Seite ist das Objektiv mit einer Abschlußplatte versehen, die einen Schutz gegen Verunreinigungen von dem Resist bildet und gleichzeitig auch das Objektiv abdichtet.

[0004] Mit zunehmender Apertur und erhöhten Wellenfrontanforderungen neuerer Systeme in der Lithographie werden die nachgeschalteten planparallelen Abschlußplatten problematischer. Eine größere Apertur bei gleichbleibendem Bildfeld erhöht zwangsläufig den Plattendurchmesser und damit bei gleicher Dicke die Durchbiegung aufgrund von z.B. Gravitation. Ein bestimmter Betrag einer Durchbiegung verschlechtert jedoch die Wellenfront bei höherer Apertur deutlich. Zwar könnte eine dickere Abschlußplatte hier Abhilfe schaffen, aber diese erhöht nicht nur das Eigengewicht des Objektivs, sondern kann darüber hinaus auch zu einer Aufheizung und daraus resultierende Bildqualitätsprobleme führen.

[0005] Aufgrund der vorstehend genannten Nachteile bei der Verwendung einer Abschlußplatte wird zum Teil versucht, auf die Abschlußplatte ganz zu verzichten. Bezüglich der optischen Auslegung eines Lithographie-Objektivs ist dies kein Problem. Wird allerdings das letzte optische Element, sei es nun eine Linse oder auch die Abschlußplatte, unbrauchbar, z.B. aufgrund von Verunreinigungen durch das Resist, so muß das ganze Objektiv zu der optischen Firma bzw. zum Hersteller zurückgesandt werden, wo eine neue Linse gefertigt und die ganze Optik nachjustiert und abgestimmt werden muß. Die Fehler, die nämlich durch eine neue Linse bzw. Abschlußplatte eingeführt werden, sind in aller Regel so groß, daß eine neue Abstimmung unverzichtbar ist. Die neue Linse bzw. die Abschluß-

platte weist zwangsweise Homogenitätsfehler, Oberflächenfehler und bei einer Linse auch einen Versatz und Zentrierfehler auf, wozu mechanische Zwänge durch die Fassung, in der die Linse eingesetzt ist, hinzukommen.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, die vorstehend genannten Nachteile zu vermeiden, insbesondere ein Objektiv zu schaffen, bei dem das letzte optische Element, das gegenüber Beschädigungen und Verunreinigungen besonders gefährdet ist, bei Bedarf leicht ausgetauscht werden kann.

[0007] Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe durch die im kennzeichnenden Teil von Anspruch 1 genannten Merkmale gelöst.

[0008] Dadurch, daß das letzte optische Element fassungsfrei direkt mit dem vorletzten optischen Element verbunden ist, ist bei seinem Austausch keine erneute Abstimmung erforderlich. Dies bedeutet, eine Rücksendung zum Hersteller ist nicht mehr nötig.

[0009] Ein Fachmann, der ein geeignetes optisches Element vorrätig hat, kann bei Bedarf direkt vor Ort das beschädigte letzte optische Element auswechseln. Dies kann z.B. in einem Reinraum am Objektiv direkt aufgrund der auswechselbaren bzw. lösbaren Verbindung des letzten optischen Elementes mit dem vorletzten optischen Element in einer sauberen Umgebung mühelos und in kurzer Zeit erfolgen.

[0010] Wenn in einer sehr vorteilhaften Weiterbildung der Erfindung dabei vorgesehen ist, daß das letzte optische Element als dünne äquidistante Platte ausgebildet ist, dann können jedwede Einstell- oder Abstimmungsarbeiten entfallen, denn optisch spielt es dann keine Rolle wie genau die äquidistante Platte seitlich sitzt oder wie genau sie zentriert ist, da sie (gekrümmt oder eben) an jeder Stelle gleich dick ist.

[0011] Eine weitere sehr vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung kann darin bestehen, daß das letzte optische Element durch Ansprengen mit dem vorletzten optischen Element verbunden ist. Auf diese Weise wird eine einfache fassungsfreie und auswechselbare Verbindung des letzten optischen Elementes mit dem vorletzten optischen Element erreicht. In diesem Fall liegen die beiden optischen Elemente ohne Luft aneinander, was in der Fügetechnik als „Ansprengen“ oder „physical glue“ bezeichnet wird. Beim Ansprengen werden die Atomkräfte auf ganz kurze Distanz ausgenutzt.

[0012] Bei Verwendung eines letzten optischen Elementes aus kristallinem Material wird man in vorteilhafter Weise auf der dem vorletzten optischen Element zugewandten Seite eine amorphe anorganische Schicht, z.B. Quarzglas, aufbringen. Zwar ist grundsätzlich auch ein Ansprengen eines optischen Elementes aus kristallinem Material möglich, aber da die Kristalle, wie z.B. Kalziumfluorid oder Kaliumfluorid, bezüglich ihrer Atomkräfte nach außen nur eine geringere Fernwirkung haben, wird durch das Aufbringen einer amorphen anorganischen Schicht, z.B. ein Aufdampfen,

erreicht, daß bei diesem Aufdampfen z.B. die Atome von Siliciumoxid im Vakuum in die Kristallstruktur eindringen, womit eine bessere Haftung erreicht wird.

[0013] Als letztes optisches Element kann die bekannte Abschlußplatte vorgesehen sein oder anstelle einer gesonderten Abschlußplatte auch das letzte optische Element, nämlich die letzte Linse des Objektives. Im letzteren Falle bedeutet dies eigentlich, daß man die letzte Linse nunmehr zweiteilig ausbildet, wobei das äußere Teil im Vergleich zum inneren Teil in einer erfindungsgemäßen Ausgestaltung sehr dünn ist und die fassungsfreie Verbindung zwischen dem äußeren Teil und dem inneren Teil der Linse liegt. Mit anderen Worten, das innere Teil der Linse ist in bekannter Weise in einer Fassung gehalten, während das äußere Teil der Linse fassungsfrei und auswechselbar mit dem inneren Teil der letzten Linse verbunden ist. In diesem Falle entfällt die bekannte Abschlußplatte ersatzlos.

[0014] Ein vorteilhaftes Verfahren zum Herstellen des letzten optischen Elementes ist in Anspruch 14 beschrieben.

[0015] Als letztes optisches Element wird man im allgemeinen eine dünne Scheibe bzw. äquidistante Platte vorsehen. Die Herstellung einer derartigen dünnen Scheibe mit einer entsprechenden Genauigkeit bzw. mit Vermeidung von Materialfehlern ist jedoch problematisch bzw. eine derartige Platte muß entsprechend genau sein, damit sie ohne Veränderung der optischen Eigenschaften des Objektives in der erfindungsgemäßen Weise vor Ort anstelle des beschädigten optischen Elementes eingesetzt werden kann. Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren läßt sich dies auf relativ einfache Weise erreichen. Dies wird insbesondere durch die Bearbeitung an einem Hilfsstück möglich, dessen Werte bekannt sind, weshalb die Durchtrittswerte der auf dem Hilfsstück zu bearbeitenden Scheibe bzw. Platte, die später als neues optisches Element verwendet werden soll, den Erfordernissen entsprechend durch eine Bearbeitung der Oberflächen angepaßt werden kann.

[0016] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen des Objektives ergeben sich aus den übrigen Unteransprüchen und dem nachfolgend anhand der Zeichnung prinzipmäßig beschriebenen Ausführungsbeispiel.

[0017] Es zeigt:

Figur 1 eine letzte Linse eines Objektives mit einer daran angesprengten äquidistanten optischen Platte;

Figur 2 eine vergrößerte Darstellung des strichpunktierten Kreises X in der Fig. 1 mit Beschichtungsflächen zwischen der Linse und einer optischen Platte als letztem optischen Element;

Figur 3 eine vergrößerte Darstellung des strichpunktierten Kreises X in der Fig. 1 mit

Beschichtungsflächen zwischen der Linse und einer optischen Platte mit einer zweigeteilten Linse als letztem optischen Element;

Figur 4 ein Grundkörper, von dem eine dünne Scheibe bzw. Platte abgetrennt wird;

Figur 5 die Anordnung einer dünnen Scheibe bzw. Platte als letztes optisches Element an einem Hilfsstück zur Bearbeitung, und

Figur 6 ein Objektiv mit mehreren Linsen.

[0018] Wie aus der Fig. 1 ersichtlich ist, ist das letzte optische Element 1 eines in der Fig. 6 nur prinzipmäßig und vereinfacht dargestellten Objektives 10, das mit mehreren in Fassungen gelagerten Linsen als optische Elemente versehen ist, in einer Halbleiter-Lithographie-Projektionsbelichtungsanlage ohne eine Fassung direkt auf dem nunmehr vorletzten optischen Element 2 des Objektives 10 gehalten. Die Verbindung erfolgt durch ein sogenanntes Ansprengen, d.h. die beiden optischen Elemente 1 und 2 liegen ohne Luft direkt aneinander an. Wenn die Linse 2 aus kristallinem Material, z.B. einem Fluorid wie CaF_2 , MgF_2 oder NaF besteht, dann wird zur Verbesserung der Ansprengung eine dünne Schicht 3 aus amorphem anorganischem Material, wie z.B. Quarzglas (SiO_2), auf einer Ansprengfläche 4 der Linse 2 aufgebracht. Die dünne Schicht 3 kann mit bekannten Techniken aufgebracht werden, wie z.B. ein Aufputtern von SiO_2 auf MgF_2 , was eine gut haftende Schicht mit guter Glättungswirkung ergibt.

[0019] Die dünne Schicht 3 kann auch aus dem gleichen Stoff, aber in amorpher Form, wie die Linse 2 bestehen, wobei dann natürlich die Adhäsion zwar nicht verbessert ist, aber die Glättung wirkt.

[0020] Aus der Fig. 2 ist in vergrößerter Darstellung entsprechend dem Kreis X nach der Fig. 1 ein Ansprengen von zwei optischen Elementen 1 und 2 ersichtlich, bei dem beide optischen Elemente 1 und 2 aus einem Kristall bestehen. In diesem Falle sind beide optischen Elemente mit einer Bedampfung aus SiO_2 oder Al_2O_3 an der Ansprengfläche 4 versehen.

[0021] Die Fig. 3 zeigt in vergrößerter Darstellung eine ähnliche Ausgestaltung, wobei lediglich eine Bedampfung des optischen Elementes 2, nämlich der Linse, an der Ansprengfläche 4 vorgenommen worden ist.

[0022] Aus den beiden vergrößerten Darstellungen in den Figuren 2 und 3 ist auch ersichtlich, daß beide optischen Elemente 1 und 2 an der Ansprengfläche 4 jeweils mit einer rundpolierten Kante 5 versehen sind. Selbstverständlich kann es gegebenenfalls auch ausreichend sein, nur eine der beiden Kanten rund zu polieren. Die rundpolierte Kante 5 oder die rundpolierten Kanten 5 dienen als Absprenghilfe bei einem Austausch des letzten optischen Elementes 1 aufgrund eines Ver-

schleißes bzw. einer Beschädigung durch ein nachgeordnetes Resist.

[0023] Auf der dem Resist zugewandten Seite ist das letzte optische Element 1 in üblicher Weise mit einer Entspiegelungsschicht versehen.

[0024] Das letzte optische Element 1 kann eine Abschlußplatte sein oder auch eine Linse, die z.B. als dünneres äußeres Teil von der letzten Linse 2 „abgetrennt“ worden ist. Mit anderen Worten, in diesem Fall ist die letzte Linse des Objektivs 10 zweiteilig ausgebildet mit einem inneren Teil und einem äußeren Teil, wobei das wesentlich dünnere äußere Teil fassungsfrei und durch Ansprengen mit dem inneren Teil der Linse verbunden ist.

[0025] Um die Dauerhaftigkeit der Ansprengung im Betrieb weiter zu erhöhen, ist es auch möglich, dem letzten optischen Element 1 bzw. der Abschlußplatte einen leicht flacheren Radius bzw. flacheren Bogenverlauf als dem vorletzten optischen Element 2 an der Ansprengfläche 4 zu geben. Nach dem Ansprengen liegen dann identische Radien vor. Das angesprengte Element, nämlich das letzte optische Element 1, übt jedoch durch geringe Biegekräfte etwas Druck auf den Ansprengrand aus. Da sich Ansprengungen in der Regel von der Mitte her lösen, läßt sich so die Dauerhaftigkeit der Ansprengung weiter verbessern.

[0026] Anhand der Figuren 4 und 5 wird nachfolgend eine mögliche Herstellungsform des letzten optischen Elementes 1 beschrieben.

[0027] An einem dickeren optischen Material als Basisstück 6 wird eine optische Fläche 8 bearbeitet und zwar entsprechend den Erfordernissen plan oder mit einem Radius. Gegebenenfalls wird diese optische Fläche 8 mit einer Haftschrift, z.B. SiO_2 , versehen. Anschließend wird eine dünne Scheibe bzw. Platte z.B. mit einer Diamantsäge von dem Basisstück 6 abgesägt. Die äquidistante Scheibe bzw. Platte 1' wird an ein Hilfsstück 7 von sehr guter Homogenität mit sehr guten Oberflächen angesprengt. Auf dem Hilfsstück 7 wird dann die optische Fläche 9 der Platte 1', die der zuvor bearbeitenden optischen Fläche 8 gegenüberliegt und die an der späteren Ansprengfläche 4 zur Anlage kommt, bearbeitet.

[0028] Das Hilfsstück 7 selbst ist interferometrisch im Durchgang sehr genau bekannt. Die der späteren Ansprengfläche zugewandte optische Fläche 9 wird nun unter Kontrolle der Oberfläche, abschließend unter Kontrolle des Durchtritts den Erfordernissen entsprechend gefertigt. Dies kann z.B. durch Roboterpolieren/Ionenstrahlpolieren erfolgen. Bei der Kontrolle der Platte 1' wird die Wellenfront des Hilfsstücks 7 abgezogen, womit der Durchtritt der dünnen Platte 1' übrig bleibt. Mit dünner Platte 1' ist hier etwa 0,5 bis 1,0 mm Dicke gemeint. Alle Einflüsse, wie etwa Bedampfung, Schichtdickenvariation (Haftschrift), Homogenität, Fehler der zuerst an dem Basisstück 6 bearbeiteten Oberfläche 8 werden erkannt, integral gemessen und können entsprechend beseitigt werden.

[0029] Mit einer derartigen Platte als optischem Element 1 läßt sich ein beschädigtes optisches Element eines Objektivs 10 auf einfache Weise und schnell ersetzen. Denkbar ist es, bereits bei der Auslieferung eines Objektivs 10 werkseitig ein oder mehrere derartige Ersatzplatten 1 als Zubehör mit auszuliefern. Auf diese Weise ist es dann möglich, schon ab Werk das Objektiv 10 mit mehreren Ersatzplatten als qualifizierter Lieferumfang zu versehen.

Patentansprüche

1. Objektiv, insbesondere Objektiv für eine Halbleiter-Lithographie-Projektionsbelichtungsanlage, mit mehreren in Fassungen gelagerte optische Elemente, dadurch gekennzeichnet, daß das in Strahlrichtung letzte optische Element (1) fassungsfrei und auswechselbar direkt mit dem vorletzten optischen Element (2) verbunden ist.
2. Objektiv nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das letzte optische Element als dünne äquidistante Platte (1) in gebogener oder ebener Form ausgebildet ist.
3. Objektiv nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß das letzte optische Element (1) durch Ansprengen mit dem vorletzten optischen Element (2) verbunden ist.
4. Objektiv nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß an der Ansprengfläche (4) wenigstens eines der beiden optischen Elemente (1,2) mit einer rundpolierten Kante (5) versehen ist.
5. Objektiv nach Anspruch 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, daß der Radius des letzten optischen Elementes (1) leicht flacher ist als der Radius des vorletzten optischen Elementes (2) an der Ansprengfläche (4).
6. Objektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das letzte optische Element (1) eine Abschlußplatte ist.
7. Objektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß das letzte optische Element (1) eine Linse ist.
8. Objektiv nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Linse (1) zweiteilig ausgebildet ist, wobei das äußere Teil (1) im Vergleich zum inneren Teil (2) sehr dünn ist, und wobei die fassungsfreie Verbindung zwischen dem äußeren Teil (1) und dem inneren Teil (2) der Linse liegt.
9. Objektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß bei Verwendung

eines letzten optischen Elementes (1) aus kristallinem Material auf der dem vorletzten optischen Element (2) zugewandten Seite eine amorphe anorganische Schicht (3) aufgebracht ist.

5

10. Objektiv nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß bei Verwendung eines vorletzten und eines letzten optischen Elementes (1) aus kristallinem Material bzw. bei einer zweiteiligen Linse als letztem optischen Element aus kristallinem Material die optischen Elemente (1,2) an der Ansprengfläche (4) jeweils mit einer amorphen anorganischen Schicht (3) versehen sind.

10

15

11. Objektiv nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß das kristalline Material ein Fluorid ist.
12. Objektiv nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekennzeichnet, daß die amorphe anorganische Schicht (3) eine oxydische Schicht ist.
13. Objektiv nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die oxydische Schicht aus Quarzglas besteht.
14. Verfahren zur Herstellung eines dünnen optischen Elementes aus kristallinem Material als letztes optisches Element eines Objektivs, insbesondere eines Objektivs für eine Halbleiter-Lithographie-Projektionsbelichtungsanlage, insbesondere mit einer geringen Dicke von weniger als 5 mm, dadurch gekennzeichnet, daß an einem Rohling (6) eine Fläche (8) auf Endform bearbeitet wird, anschließend von dem Rohling (6) eine dünne Scheibe (1') abgetrennt wird, die Scheibe (1') mit einem Hilfsstück (7) verbunden wird, wonach abschließend die der zuvor bearbeiteten Fläche (8) gegenüberliegende Fläche (9) der Scheibe (1') bearbeitet wird.
15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, daß die dünne Scheibe (1') durch Ansprengen mit dem Hilfsstück (7) verbunden wird.
16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, daß die zuletzt bearbeitete Fläche (9) der Scheibe (1') mit einer amorphen organischen Schicht (3) beschichtet wird.

20

25

30

35

40

45

50

55

FIG.1

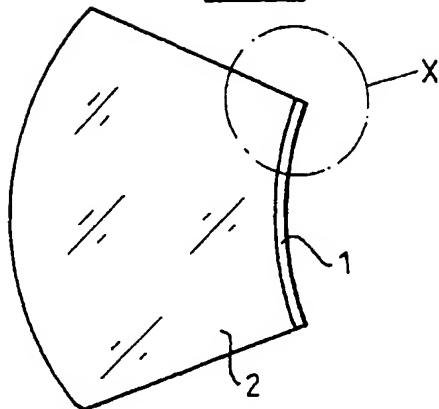


FIG.2

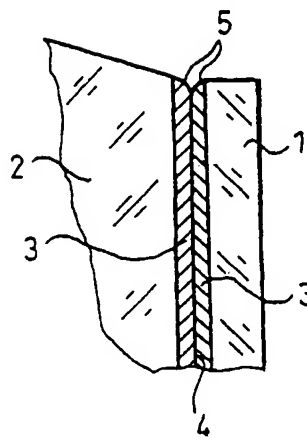


FIG.3

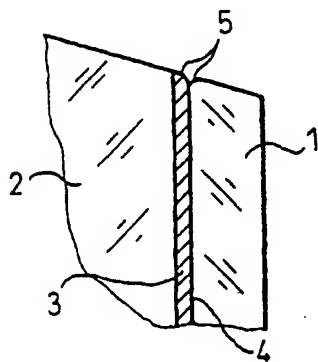


FIG.6

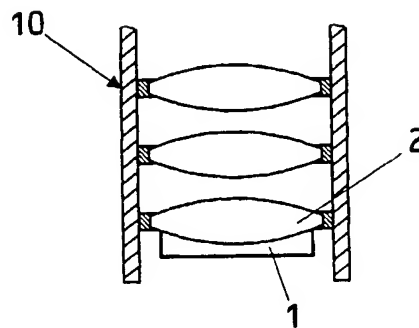


FIG.4

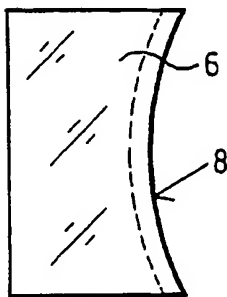
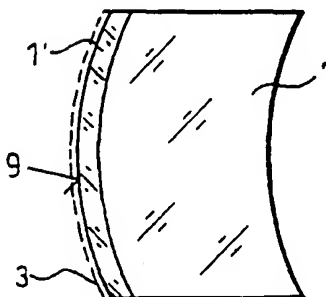


FIG.5





Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 00 10 8927

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (INCL.7)
X	EP 0 857 985 A (ZEISS CARL ; ZEISS STIFTUNG (DE)) 12. August 1998 (1998-08-12)	14, 15	602B13/14 602B13/24
A	* Spalte 2, Zeile 31 - Spalte 3, Zeile 32; Anspruch 9 *	1-3, 7, 9-13, 16	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 018, no. 530 (P-1809), 6. Oktober 1994 (1994-10-06) & JP 06 186405 A (NIKON CORP), 8. Juli 1994 (1994-07-08) * Zusammenfassung *	1, 14	
A	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 017, no. 448 (P-1594), 17. August 1993 (1993-08-17) & JP 05 100102 A (OLYMPUS OPTICAL CO LTD), 23. April 1993 (1993-04-23) * Zusammenfassung *	14	
A	US 5 889 617 A (ITO ITOE ET AL) 30. März 1999 (1999-03-30) * Abbildung 17 *	1	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (INCL.7) 602B 603F
A	EP 0 347 838 A (DAINIPPON SCREEN MFG) 27. Dezember 1989 (1989-12-27) * Seite 5, Zeile 49 - Seite 7, Zeile 17 *	1	
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort	Abschlußdatum der Recherche		Prüfer
DEN HAAG	5. Oktober 2000		Mollenhauer, R
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE			
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : nichttechnische Offenbarung P : Zitiertenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentdokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EPO FORM 1303 03.02 (P04003)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 00 10 8927

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.
Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Daten des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

05-10-2000

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 0857985 A	12-08-1998	DE 19704936 A	13-08-1998
		JP 10239501 A	11-09-1998
JP 06186405 A	08-07-1994	KEINE	
JP 05100102 A	23-04-1993	KEINE	
US 5889617 A	30-03-1999	JP 8082745 A	26-03-1996
		JP 8082746 A	26-03-1996
		JP 8082744 A	26-03-1996
		US 5708531 A	13-01-1998
EP 0347838 A	27-12-1989	JP 1319719 A	26-12-1989
		JP 1784257 C	31-08-1993
		JP 4076452 B	03-12-1992
		JP 1319720 A	26-12-1989
		JP 1784258 C	31-08-1993
		JP 4076453 B	03-12-1992
		US 5121255 A	09-06-1992

EPO FORM P0461

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82